

論文 / 著書情報
Article / Book Information

題目(和文)	ナノ構造創製を目指したブロック共重合体の形態制御と側鎖型液晶ポリマー材料の開発
Title(English)	Morphology Control of Block Copolymers and Development of Side Chain Liquid Crystalline Polymers for Nanofabrication
著者(和文)	加藤史修
Author(English)	Fuminobu Kato
出典(和文)	学位:博士(工学), 学位授与機関:東京工業大学, 報告番号:甲第10621号, 授与年月日:2017年9月20日, 学位の種別:課程博士, 審査員:早川 晃鏡,芹澤 武,石曾根 隆,戸木田 雅利,道信 剛志
Citation(English)	Degree:Doctor (Engineering), Conferring organization: Tokyo Institute of Technology, Report number:甲第10621号, Conferred date:2017/9/20, Degree Type:Course doctor, Examiner:,,,,,
学位種別(和文)	博士論文
Category(English)	Doctoral Thesis
種別(和文)	審査の要旨
Type(English)	Exam Summary

(博士課程)

論文審査の要旨及び審査員

報告番号	甲第	号	学位申請者氏名	加藤 史修		
論文審査 審査員		氏名	職名		氏名	職名
	主査	早川晃鏡	准教授	審査員	道信剛志	准教授
	審査員	芹澤武	教授			
		石曾根隆	教授			
戸木田雅利		准教授				

論文審査の要旨 (2000 字程度)

本論文は“Morphology Control of Block Copolymers and Development of Side Chain Liquid Crystalline Polymers for Nanofabrication”「ナノ構造創製を目指したブロック共重合体の形態制御と側鎖型液晶ポリマー材料の開発」と題し、英文で書かれており、以下の6章から構成されている。

第1章“General Introduction”「緒論」では、本研究の背景を概観し、研究の意義と目的について述べている。

第2章“Morphology Control of POSS-containing Triblock Copolymers on the Addition of a Short Middle Block Chain”「短いミドルブロック鎖の導入によるかご形シルセスキオキサン (POSS) 含有トリブロック共重合体の形態制御」では、ポリスチレン(PS)セグメントとポリ (POSS メタクリレート) (PMAPOSS)セグメントとを短いポリイソブレン (PI)セグメントで連結することで、PS-block-PMAPOSS 共重合体では見られなかった PMAPOSS セグメントの円柱状ドメインが形成されることを見出している。PI 鎖長によるマイクロ相分離構造の形態変化について検討することで、一次構造制御における PMAPOSS シリンダー構造の形成条件を明らかにしたうえで、PMAPOSS セグメントの円柱状ドメイン形成の発現が PI 鎖の界面における相互侵入効果によると結論している。

第3章“Morphology Control with the Steric Bulk of Polymethacrylate in POSS-containing Diblock Copolymers”「POSS 含有ブロック共重合体におけるポリメタクリレート側鎖による形態制御」では、ポリ (*n*-ブチルメタクリレート) (P*n*BMA) と PMAPOSS からなるジブロック共重合体である P*n*BMA-*b*-PMAPOSS 共重合体をリビングアニオン重合により合成し、PMAPOSS 円柱構造形態の形成を実現している。この円柱構造の形成は P*n*BMA セグメントのブチル側鎖の立体効果により PMAPOSS の凝集が低減するためであると結論している。また、表面改質シリコン基板面上に平行に配向した PMAPOSS シリンダー構造を形成させ、酸素プラズマエッチング (O₂-RIE) による P*n*BMA ドメインの選択的分解を行い、線幅 14 nm のラインアンドスペース (L/S) パターンの創出に成功している。

第4章“Development of POSS-containing Liquid Crystalline Diblock copolymer for Rectangular Patterning”「方形パターン形成を目指した POSS 含有液晶性ブロック共重合体の開発」では、POSS 含有ブロック共重合体のナノ構造形態の多様化を目指し、PMAPOSS セグメントと側鎖にオゾン分解性アルキル・スパーサーを介してメソゲン基を有する側鎖型液晶性 PMC_{6,11}B セグメントからなる PMAPOSS-*b*-PMC_{6,11}B 共重合体をリビングアニオン重合により合成し、PMC_{6,11}B セグメントの層構造、及び2種のブロックのマイクロ相分離構造からなる階層的秩序構造の形成を明らかにしている。また、メタノール中で PMC_{6,11}B セグメントをオゾン分解し、マイクロ相分離構造の選択的分解反応の進行を確認している。

第5章“Development of Liquid Crystalline Polymers for Sub-10 nm Nanopatterning”「10 ナノメートル以細の微細構造形成に向けた液晶性ポリマーの開発」では、メソゲンとアルキル・テール鎖がイミノ基で結合した2種類の側鎖型液晶ポリマー (PSC_{1,10}B、PSC_{1,36}B) を可逆的付加開裂連鎖移動重合で合成、成膜後、酸性蒸気下で加水分解あるいは O₂-RIE によりテール鎖を脱離し、10 ナノメートル以細の L/S パターンの創出に成功している。さらに、PSC_{1,10}B、PSC_{1,36}B のモノマー分子の溶液をシリコン基板上に成膜、熱ラジカル重合によりポリマーとした後 O₂-RIE を行うことで同様の L/S パターンが得られることを見出している。

第6章“General Conclusion”「総括」では、各章で得られた結果について総括すると共に、今後の展望を述べている。

これを要するに、本論文は多様な次世代電子デバイスに有用とされる線幅 10 ナノメートル以細のパターニングを可能とするポリマーの一次構造、および形態制御を基盤とする高分子材料への開発指針を示すものであり、工学上ならびに工業上貢献するところが大きい。よって本論文は博士 (工学) の学位論文として十分な価値があるものと認められる。

注意: 「論文審査の要旨及び審査員」は、東工大リサーチポジトリ(T2R2)にてインターネット公表されますので、公表可能な範囲の内容で作成してください。